

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 19 年 8 月 23 日 (2007.8.23)

【公開番号】特開 2002-26389 (P2002-26389A)

【公開日】平成 14 年 1 月 25 日 (2002.1.25)

【出願番号】特願 2000-207701 (P2000-207701)

【国際特許分類】

H 0 1 L 33/00 (2006.01)

C 2 3 C 16/34 (2006.01)

H 0 1 L 21/205 (2006.01)

H 0 1 L 21/324 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 33/00 C

C 2 3 C 16/34

H 0 1 L 21/205

H 0 1 L 21/324 C

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 7 月 5 日 (2007.7.5)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 7 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 7 6】

第 2 の実施形態と同様にして M O C V D 法により製造した多層構造を有するウェーハについて、第 2 の実施形態と同様の方法で表面に C o 薄膜を形成し、酸素を含む窒素ガス雰囲気中で 1 0 分間の熱処理を施すことで A l G a N 層中の M g を活性化するとともに、C o 薄膜を除去し、A l G a N からなる p 型層を製造した。